PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-291265

(43)Date of publication of application: 19.10.2001

(51)Int.Cl.

G11B 7/135 G11B 7/0033 7/004 G11B G11B 7/14 HQ1S 5/18

(21)Application number: 2001-043477

(71)Applicant:

NEC CORP

(22)Date of filing:

20.02.2001

(72)Inventor:

SAKAGUCHI MITSUHITO

THIO TINEKE LINKE RICHARD A

EBBESEN THOMAS W LEZEC HENRI J

(30)Priority

Priority number: 2000 185239

Priority date: 28.02.2000

Priority country: US

2000 721694

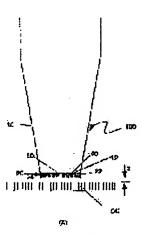
27.11.2000

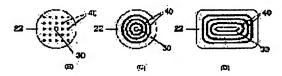
US

(54) READING/WRITING HEAD BY SURFACE PLASMON AMPLITUDE FOR OPTICAL DATA STORAGE MEDIUM (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reading/writing head using a near-field optical system which is provided with the dimension of a short pit length, obtains the speed of reading/writing of high data density and high speed, does not receive severe attenuation, and is capable of performing both writing and reading of data on and from an optical storage medium such as a phase transition medium.

SOLUTION: A plasmon amplitude device 20 is provided in the end surface 12 of a waveguide 10. The plasmon amplitude device 20 is composed of a metallic film 22 having the aperture 30 of the diameter not longer than a wavelength which is provided by being penetrated, and the metallic film 22 is provided with a cyclic surface potography 40 provided on at least one side of surface. Light incident on one side of the surface of the metallic film 22 interacts with a surface plasmon mode in at least one side of the surface of the metallic film. Thus, transmitting light passing through the aperture 30 is amplified.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.02.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3642283

[Date of registration]

04.02.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-291265 (P2001-291265A)

(43)公開日 平成13年10月19日(2001.10.19)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
G11B	7/135		G11B	7/135	Α
	7/0033			7/0033	
	7/004			7/004	Z
	7/14			7/14	
H01S	5/18		H01S	5/18	
			審査	請求 有	請求項の数75 OL (全 15 頁)

(21)出願番号 特願2001-43477(P2001-43477) (71)出願人 000004237

(22)出願日 平成13年2月20日(2001.2.20)

(31)優先権主張番号 60/185239

(32)優先日 平成12年2月28日(2000.2.28)

(33)優先権主張国 米国(US)

(31)優先権主張番号 09/721694

(32)優先日 平成12年11月27日(2000, 11, 27)

(33)優先権主張国 米国(US)

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 阪口 光人

アメリカ合衆国、 ニュージャージー 08540、 プリンストン、 インディペン デンス ウェイ 4 エヌ・イー・シー・ リサーチ・インスティテューテュ・インク 内

(74)代理人 100088328

(外2名) 弁理士 金田 暢之

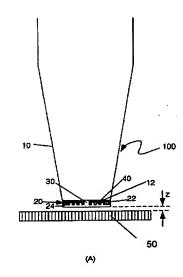
最終頁に続く

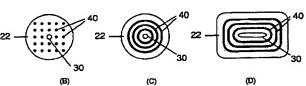
(54)【発明の名称】 光データ記憶媒体用の表面プラズモン増幅による読み出し/書き込みヘッド

(57)【要約】

【課題】短いピット長寸法を備え、高データ密度と高速 の読み出し/書き込み速度をもたらし、厳しい減衰を受 けず、相変化媒体のような光記憶媒体上のデータの書き 込み及び読み出しをともに可能にする、近視野光学系を 用いる読み出し/書き込みヘッドを提供する。

【解決手段】導波路10の端面12にプラズモン増幅デ バイス20を設ける。プラズモン増幅デバイス20は、 貫通して設けられた波長以下の直径のアパーチャー30 を有する金属膜22からなり、金属膜22は、少なくと も一方の表面上に設けられた周期的な表面トポグラフィ -40を有する。金属膜22の表面の一方に入射する光 は金属膜の表面の少なくとも一方での表面プラズモン・ モードと相互作用し、これにより、アパーチャー30を 通る透過光が増幅される。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 端面を有する導波路と、

前記導波路の前記端面の上に設けられ、第1の表面と第2の表面を有する金属膜を有するプラズモン増幅デバイスと、を有し、

前記第1の表面は前記導波路の端面に固定されており、前記金属膜は前記金属膜を通して設けられたアパーチャーを有し、前記金属膜は前記金属膜の前記第1及び第2の表面の少なくとも一方の上に設けられた周期的な表面トポグラフィー(topography)を有し、前記金属膜の前記表面の少なくとも一方での表面プラズモン・モードと相互作用し、それにより、前記光記憶媒体に導かれた及び/または前記光記憶媒体から集められ前記金属膜内の前記アパーチャーを通る透過光を増幅する、光記憶媒体用の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項2】 前記光記憶媒体からの読み出し動作及び前記光記憶媒体への書き込み動作の少なくとも一方を、前記読み出し/書き込みヘッドを介して伝送される光を利用して行うように、前記金属膜の前記第2の表面は前 20記光記憶媒体にごく近接して配置されている、請求項1に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項3】 増幅された透過光が前記光記憶媒体に向けられて前記光記憶媒体上で書き込み動作を行うように、前記導波路から前記プラズモン増幅デバイスを介して光が伝送される、請求項2に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項4】 増幅された透過光が前記光記憶媒体に向けられて前記光記憶媒体を照らし前記光記憶媒体からの読み出し動作を行うように、前記プラズモン増幅デバイ 30 スを介して前記導波路から光が伝送される、請求項2に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項5】 前記光記憶媒体により反射され、前記光記憶媒体により屈折され、あるいは前記光記憶媒体を透過した光が、増幅された透過量で、前記プラズモン増幅デバイスを介して前記導波路に伝送され、前記光記憶媒体からの読み出し動作が行われる、請求項2に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項6】 前記周期的な表面トポグラフィーは、複数の表面特徴(feature)からなる請求項1に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項7】 前記表面特徴は、小さなくぼみ(dimple)、半球形の突出部、溝、突起(rib)、同心のくぼんだ環、及び同心の突起した環からなる群から選択される、請求項6に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項8】 前記周期的な表面トポグラフィーは、前記金属膜の前記第1の表面上にのみ設けられる請求項1に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項9】 前記周期的な表面トポグラフィーは、前記金属膜の前記第1の表面上及び前記第2の表面上の両 50

方に設けられる請求項1に記載の読み出し/書き込みへッド。

【請求項10】 前記導波路は光ファイバである請求項1に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項11】 前記導波路は、ほぼ剛体である光透過性の半導体である請求項1に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項12】 前記導波路は、ベース、ほぼ平坦な頂面、及び複数のファセットを有する切頭体構造を有し、各ファセットは前記ベースから前記ほぼ平坦な頂面へ延びているほぼ平面の表面であり、前記プラズモン増幅デバイスは前記切頭体構造の前記平坦な頂面上に設けられている、請求項11に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項13】 前記切頭体構造の前記ベースは正方形であり、前記切頭体は4つのファセットを有する請求項12に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項14】 前記アパーチャーは、円筒状に形成されている請求項1に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項15】 前記アパーチャーは、スリット状に形成されている請求項1に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項16】 前記金属膜の前記第2の表面に固定された光学的に透明なオーバー・レイヤをさらに有する請求項1に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項17】 前記導波路は屈折率を有し、前記オーバー・レイヤは屈折率を有し、前記オーバー・レイヤの前記屈折率は前記導波路の屈折率にほぼ等しい、請求項16に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項18】 前記読み出し/書き込みヘッドと一体の光源をさらに有する請求項1に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項19】 光記憶媒体用の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体であって、

それぞれ端面を有し、すべての端面はほぼ同じ平面内に 配置されている複数の導波路と、

前記各導波路の前記端面の上に設けられ、それぞれ第1 の表面と第2の表面を有する金属膜を有するプラズモン 増幅デバイスと、を有し、

前記第1の表面は対応する前記導波路の端面に固定されており、前記金属膜は前記金属膜を通して設けられたアパーチャーを有し、前記金属膜は前記金属膜の前記第1及び第2の表面の少なくとも一方の上に設けられた周期的な表面トポグラフィー(topography)を有し、前記金属膜の前記表面の一方に入射する光は前記金属膜の前記表面の少なくとも一方での表面プラズモン・モードと相互作用し、それにより、前記光記憶媒体に導かれた及び/または前記光記憶媒体から集められた前記金属膜内の前記アパーチャーを通る透過光を増幅する、正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項20】 前記光記憶媒体からの読み出し動作及び前記光記憶媒体への書き込み動作の少なくとも一方を、このような金属膜に対応する前記読み出し/書き込みへッドを介して伝送される光を利用して行うように、前記金属膜の前記第2の表面は前記光記憶媒体にごく近接して配置されている、請求項19に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項21】 増幅された透過光が前記光記憶媒体に向けられて前記光記憶媒体上で書き込み動作を行うように、前記各導波路から対応する前記プラズモン増幅デバ 10イスを介して光が伝送される、請求項20に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項22】 増幅された透過光が前記光記憶媒体に向けられて前記光記憶媒体を照らし前記光記憶媒体からの読み出し動作を行うように、前記各導波路から対応する前記プラズモン増幅デバイスを介して光が伝送される、請求項20に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項23】 前記光記憶媒体により反射され、前記 光記憶媒体により屈折され、あるいは前記光記憶媒体を 20 透過した光が、増幅された透過量で、前記複数のプラズ モン増幅デバイスの少なくとも1つを介して対応する前 記導波路に伝送され、前記光記憶媒体からの読み出し動 作が行われる、請求項20に記載の正確に整列された読 み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項24】 前記周期的な表面トポグラフィーは、 複数の表面特徴(feature)からなる請求項19に記載の 正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項25】 前記表面特徴は、小さなくぼみ(dimple)、半球形の突出部、溝、突起(rib)、同心のくぼんだ環、及び同心の突起した環からなる群から選択される、請求項24に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項26】 前記周期的な表面トポグラフィーは、前記金属膜の前記第1の表面上にのみ設けられる請求項19に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項27】 前記周期的な表面トポグラフィーは、前記金属膜の前記第1の表面上及び前記第2の表面上の両方に設けられる請求項19に記載の正確に整列された 40 読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項28】 前記各導波路は光ファイバである請求項19に記載の正確に整列された読み出し/書き込みへッドの配列体。

【請求項29】 前記各導波路は、ほぼ剛体である光学的に透明な半導体である請求項19に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項30】 前記各アパーチャーは、円筒状に形成されている請求項19に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項31】 前記各アパーチャーは、スリット状に 形成されている請求項19に記載の正確に整列された読 み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項32】 前記各プラズモン増幅デバイスの前記 金属膜の前記第2の表面に固定された光学的に透明なオーバー・レイヤをさらに有する請求項19に記載の正確 に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項33】 前記各導波路は屈折率を有し、前記各プラズモン増幅デバイスの前記オーバー・レイヤは屈折率を有し、前記各プラズモン増幅デバイスの前記オーバー・レイヤの屈折率は、そのプラズモン増幅デバイスに対応する前記導波路の前記屈折率にほぼ等しい、請求項32に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項34】 単一の金属膜が、前記複数のプラズモン増幅デバイスのそれぞれの前記金属膜の全体を形成する請求項19に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項35】 前記複数の導波路は、単一のほぼ剛体である光学的に透明な半導体ウエハで形成されている請求項19に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項36】 前記複数の導波路の端面は、滑らかさ及び正確なアライメントをもたらすように劈開される、請求項35に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項37】 前記複数の導波路のそれぞれは、ベース、ほぼ平坦な頂面、及び複数のファセットを有する切頭体構造を有し、各ファセットは前記ベースから前記ほぼ平坦な頂面へ延びているほぼ平面の表面であり、前記各プラズモン増幅デバイスは前記切頭体構造の前記平坦な頂面上に設けられている、請求項35に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項38】 前記切頭体構造の前記ベースは正方形であり、前記切頭体は4つのファセットを有する請求項37に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項39】 前記各読み出し/書き込みヘッドと一体の光源をさらに有する請求項19に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項40】 光記憶媒体に向かって光を導く光源と、

前記光源と前記光記憶媒体の間に設けられ、第1の表面 と第2の表面を有する金属膜を有するプラズモン増幅デ バイスと、を有し、

前記第1の表面は前記光源に向かって配置されており前 記第2の表面は前記光記憶媒体に向かって配置されてお り、前記金属膜は前記金属膜を通して設けられたアパー チャーを有し、前記金属膜は前記金属膜の前記第1及び 50 第2の表面の少なくとも1方の上に設けられた周期的な

表面トポグラフィー(topography)を有し、前記金属膜の 前記第1の表面に入射する前記光源からの光は前記金属 膜の前記表面の少なくとも一方での表面プラズモン・モ ードと相互作用し、それにより、前記光記憶媒体に導か れた前記金属膜内の前記アパーチャーを通る透過光を増 幅する、光記憶媒体用の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項41】 前記光源はレーザからなる請求項40 に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項42】 前記レーザは、半導体レーザ、端面発 光半導体レーザ、垂直共振器面発光レーザ (VCSE L; vertical cavity surface-emitting laser)、固体 レーザ及びファイバ・レーザからなる群から選択された ものである請求項41に記載の読み出し/書き込みヘッ ド。

【請求項43】 前記レーザは、後方側の分布ブラッグ 反射器 (DBR; distributed Bragg reflector) と前 記プラズモン増幅デバイスにより画定される垂直共振器 を含む垂直共振器面発光レーザ (VCSEL; vertical cavity surface-emitting laser) を有する請求項41 に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項44】 前記レーザは出力鏡及び後部鏡を有 し、前記プラズモン増幅デバイスは前記出力鏡の上に設 けられる請求項41に記載の読み出し/書き込みヘッ ۲.

【請求項45】 前記光記憶媒体により反射され前記光 記憶媒体により屈折されあるいは前記光記憶媒体を透過・ した、前記プラズモン増幅デバイスにより増幅された前 記光源からの光を集める光コレクタをさらに有する請求 項40に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項46】 前記光コレクタは、近視野モードで前 記光を集める請求項45に記載の読み出し/書き込みへ ッド。

【請求項47】 前記光コレクタは、遠視野モードで前 記光を集める請求項45に記載の読み出し/書き込みへ ッド。

【請求項48】 前記光コレクタは、前記光記憶媒体に 関し、前記光源と同じの側に配置されている請求項45 に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項49】 前記光コレクタは、前記光記憶媒体に 関し、前記光源とおは反対側に配置されている請求項4 5に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項50】 前記周期的な表面トポグラフィーは、 複数の表面特徴(feature)からなる請求項40に記載の 読み出し/書き込みヘッド。

【請求項51】 前記表面特徴は、小さなくぼみ(dimpl e)、半球形の突出部、溝、突起(rib)、同心のくぼんだ 環、及び同心の突起した環からなる群から選択される、 請求項50に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項52】 前記周期的な表面トポグラフィーは、 前記金属膜の前記第1の表面上にのみ設けられる請求項 50 40に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項53】 前記周期的な表面トポグラフィーは、 前記金属膜の前記第1の表面上及び前記第2の表面上の 両方に設けられる請求項40に記載の読み出し/書き込 みヘッド。

前記アパーチャーは、円筒状に形成さ 【請求項54】 れている請求項40に記載の読み出し/書き込みヘッ ド。

【請求項55】 前記アパーチャーは、スリット状に形 10 成されている請求項40に記載の読み出し/書き込みへ ッド。

【請求項56】 前記金属膜の前記第2の表面に固定さ れた光学的に透明なオーバー・レイヤをさらに有する請 求項40に記載の読み出し/書き込みヘッド。

【請求項57】 光記憶媒体用の正確に整列された読み 出し/書き込みヘッドの配列体であって、

前記光記憶媒体に向かって光を導く複数の光源と、

前記各光源と前記光記憶媒体の間に設けられ、それぞれ 第1の表面と第2の表面を有する金属膜を有するプラズ 20 モン増幅デバイスと、を有し、

前記第1の表面は対応する前記光源に向かって配置され ており前記第2の表面は前記光記憶媒体に向かって配置 されており、前記金属膜は前記金属膜を通して設けられ たアパーチャーを有し、前記金属膜は前記金属膜の前記 第1及び第2の表面の少なくとも1方の上に設けられた 周期的な表面トポグラフィー(topography)を有し、前記 金属膜の前記第1の表面に入射する前記光源からの光は 前記金属膜の前記表面の少なくとも一方での表面プラズ モン・モードと相互作用し、それにより、前記光記憶媒 体に導かれた前記金属膜内の前記アパーチャーを通る透 過光を増幅する、正確に整列された読み出し/書き込み ヘッドの配列体。

【請求項58】 前記光源の少なくとも1つはレーザか らなる請求項57に記載の正確に整列された読み出し/ 書き込みヘッドの配列体。

【請求項59】 前記レーザは、半導体レーザ、端面発 光半導体レーザ、垂直共振器面発光レーザ(VCSE L; vertical cavity surface emitting laser)、固体 レーザ及びファイバ・レーザからなる群から選択された ものである請求項58に記載の正確に整列された読み出 し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項60】 前記レーザは、後方側の分布ブラッグ 反射器(DBR; distributed Bragg reflector)と前 記プラズモン増幅デバイスにより画定される垂直共振器 を含む垂直共振器面発光レーザ(VCSEL; vertical cavity surface emitting laser) を有する請求項58 に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの 配列体。

前記レーザは出力鏡及び後部鏡を有 【請求項61】 し、前記プラズモン増幅デバイスは前記出力鏡の上に設

けられる請求項58に記載の正確に整列された読み出し / 書き込みヘッドの配列体。

【請求項62】 前記光記憶媒体により反射され前記光記憶媒体により屈折されあるいは前記光記憶媒体を透過した、前記プラズモン増幅デバイスにより増幅された前記各光源からの光を集める光コレクタをさらに有する請求項57に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項63】 前記光コレクタは、近視野モードで前記光を集める請求項62に記載の正確に整列された読み 10出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項64】 前記光コレクタは、遠視野モードで前記光を集める請求項62に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項65】 前記光コレクタは、前記光記憶媒体に 関し、前記光源と同じの側に配置されている請求項62 に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの 配列体。

【請求項66】 前記光コレクタは、前記光記憶媒体に関し、前記光源とおは反対側に配置されている請求項62に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項67】 前記周期的な表面トポグラフィーは、 複数の表面特徴(feature)からなる請求項57に記載の 正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項68】 前記表面特徴は、小さなくぼみ(dimple)、半球形の突出部、溝、突起(rib)、同心のくぼんだ環、及び同心の突起した環からなる群から選択される、請求項67に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項69】 前記周期的な表面トポグラフィーは、前記金属膜の前記第1の表面上にのみ設けられる請求項57に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項70】 前記周期的な表面トポグラフィーは、前記金属膜の前記第1の表面上及び前記第2の表面上の両方に設けられる請求項57に記載の正確に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項71】 前記各アパーチャーは、円筒状に形成されている請求項57に記載の正確に整列された読み出 40 し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項72】 前記各アパーチャーは、スリット状に 形成されている請求項57に記載の正確に整列された読 み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項73】 前記各プラズモン増幅デバイスの前記 金属膜の前記第2の表面に固定された光学的に透明なオ ーバー・レイヤをさらに有する請求項57に記載の正確 に整列された読み出し/書き込みヘッドの配列体。

【請求項74】 端面発光レーザであって、 後部鏡と、 出力鏡と、

前記後部鏡と前記出力鏡の間に配置された量子井戸と、 前記出力鏡の上に設けられ、第1の表面及び第2の表面 を有する金属膜を有するプラズモン増幅デバイスと、を 有し、

前記第1の表面は前記量子井戸に向かって配置され前記第2の表面は前記端面発光レーザの出力に向かって配置されており、前記金属膜は前記金属膜を通して設けられたアパーチャーを有し、前記金属膜は前記金属膜の前記第1及び第2の表面の少なくとも一方の上に設けられた周期的な表面トポグラフィー(topography)を有し、前記金属膜の前記第1の表面に入射する光は前記金属膜の前記表面の少なくとも一方での表面プラズモン・モードと相互作用し、それにより、前記端面発光レーザから導かれた前記金属膜内の前記アパーチャーを通る透過光を増幅する、端面発光レーザ。

【請求項75】 垂直共振器面発光レーザ(VCSE L; vertical cavity surface-emitting laser)であって、

後方側の分布ブラッグ反射器(DBR;distributed Bragg reflector)と、

前記分布ブラッグ反射器との間で垂直共振器を画定し、 第1の表面と第2の表面を有する金属膜を有するプラズ モン増幅デバイスと、を有し、

前記第1の表面は前記垂直共振器に向かって配置され前記第2の表面は前記垂直共振器面発光レーザの出力に向かって配置されており、前記金属膜は前記金属膜を通して設けられたアパーチャーを有し、前記金属膜は前記金属膜の前記第1及び第2の表面の少なくとも一方の上に30 設けられた周期的な表面トポグラフィー(topography)を有し、前記金属膜の前記第1の表面に入射する光は前記金属膜の前記表面の少なくとも一方での表面プラズモン・モードと相互作用し、それにより、前記垂直共振器面発光レーザから導かれた前記金属膜内の前記アパーチャーを通る透過光を増幅する、垂直共振器面発光レーザ。

[0001]

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】本発明は、データ記憶装置に関し、特に、金属膜内の波長以下(subwavelength)の大きさのアパーチャー(開口)を介する表面プラズモン増幅光透過(surfaceplasmon-enhanced optical transmission)を利用する、非常に高いスループットと分解能を有する光データ記憶装置用の読み出し/書き込みデバイスに関する。

[0002]

【背景技術】Ebbesenらへの米国特許第5,973,316号明細書(特開平11-72607号公報)、Kimらへの米国特許第6,040,936号明細書(特開2000-111851号公報)、Ebbesenらへの米国特許第6,052,238号明細書(特開平11-72607号公報)、1998年12月9日に出願されたEbbesenらの米国特

許出願番号第09/208,116号(特開2000-171763号公 報)、及び1999年11月5日に出願されたKimらの米国特許 出願番号第09/435,132号 (これらの特許及び特許出願の それぞれは参考文献として本明細書に包含される)に詳 細に説明するように、薄い金属膜(すなわち関心のある 波長において導電性かつ不透明である膜)の中に設けら れた1つ以上の波長以下の直径のアパーチャーを介する 透過光は、アパーチャーを周期的な配列で配置すること により、及び/またはアパーチャーと連係して前記金属 膜の上に周期的な表面トポグラフィー(小さなくぼみ(d 10 imple)あるいは突出部のような表面特徴(feature))を 設けることにより、大幅に増幅することができる。1. 000倍にも達することがあるこの増幅は、導電性の膜 に入射する光が表面プラズモン・モードと共鳴的に相互 作用するときに起こる。

【0003】CD-ROM(コンパクトディスクー読み 出し専用メモリ)及びDVD(デジタルビデオディス ク) のような光記憶ディスクは、その高いデータ記録密 度、コンパクトな設計、ポータビリティ及び頑強性(ロ バストさ)により、また特に媒体及び書き込み装置の両 20 方が低価格になりつつあるために、ますます魅力的なデ ータ記憶媒体になりつつある。光ディスクにより提供さ れる比較的高いデータ密度にもかかわらず、さらに高い 密度が望ましいと考えられている。しかし、現在の値を 超えて記録密度を増加するためには、データを書き込み あるいは読み取る光ビームのサイズを小さくすることが¹ 必要である。書き込み及び読み出しビームの強度も劇的 に減少させなければ、これは実行不能であることが証明 されており、したがってデータ記憶が不可能となる。さ らに、このような光ディスクは、一般に、読み出し速度 (光ディスクから読み出すことができるデータの速度) が比較的低い点でも、著しい欠点を通常示す。

【0004】本発明は、高解像度にもかかわらず非常に 高いパワー・スループットで、光ディスク上の波長以下 のスケールでの読み出し及び書き込みを可能にする光読 み出し/書き込みヘッドを提供することにより、両方の 課題を是正する。その結果、回折限界により可能とされ る線データ密度よりはるかに高い線データ密度(したが って読み出し/書き込み速度)を可能にする。(光ビー ムの焦点を合わせるためにレンズあるいは他の遠視野集 40 東デバイスを使用するとき、焦点における収束光の「ス ポット」の寸法は、回折により直径 $\lambda/2$ (λ は光の波 長である)に制限される。これは、回折限界として公知 の現象である。)より小さいスポットは、光記憶媒体上 のより高いデータ記憶密度をもたらし、媒体の与えられ た回転速度に対してより高いデータ読み出し速度をもた らす。このような読み出し/書き込みヘッドの1次元配 列体を介する多重チャネルの読み出し及び/または書き 込みは、データ転送速度をさらに増加させる。さらに、 これらの利点は現在市販されているものよりも短い波長 50 号対雑音比と、書き込みに必要な高い強度の欠如とな

を有するレーザに頼ることなく実現され、したがって本 発明は、在庫のあるレーザ装置を使用する実際的な応用 例を与える。

【0005】現在商業的に使用されている書き換え可能 なCD-ROM光ディスクは、相変化媒体上のトラック の上に「ピット(pit)」としてデータを蓄積する。トラ ックは1.6 μ mのピッチを有し、ピット長は0.4 μ m から1. 2μmの間で変化する。集束集光光学機器のた めにかなり大きいレンズを使用して書き込み及び読み出 しともに遠視野で行うので、現在使用中のレーザ(CD -ROM用には $\lambda = 780$ nm)の回折限界により、ピ ット長の下限が与えられる。より高いデータ密度は、記 億媒体の複数の層を積み重ねることにより実現される。 現在入手可能なDVDディスクは、(0.65GBを収 容する)標準のCD-ROMのデータの約8倍までのデ ータを格納する。さらにより高いデータ密度を得ること が望ましいが、いっそう深刻な課題はデータを読み出す 速度であり、これは、現在、ディスク回転の機械的安定 性、したがってディスクの回転速度により、制限されて いる。

【0006】これらの課題を緩和するためには、このよ うな光データ記憶媒体のピット長を大幅に減少させるこ とが望ましい。遠視野光学系 (ここでは、読み出し/書 き込みヘッドと光記憶媒体の間の距離は光の波長よりは るかに大きい)が使用されれば、最少ピット長は回折限 界により与えられる。例えば、青緑色レーザに変える と、約300nmのピット長が可能になるであろう。

【0007】しかし、光データ記憶媒体へのデータの読 み出し及び/または書き込みに、(波長以下のサイズの アパーチャーを有する読み出し/書き込みヘッドが、光 記憶媒体の上の約数十nmの高さで走査される)近視野 光学系が使用できれば、ピット長は、(読み出し/書き 込みアパーチャーの寸法によってのみ制限され、)50 nm以下とすることが可能であり、高いデータ密度と大 幅に高められた書き込み及び/または読み出し速度をも たらす。これらの利点は、従来の赤色ダイオード・レー ザ、あるいは安くて信頼性が高く大量に生産することが できる赤外ダイオード・レーザを使用しても実現され る。付加的な利点は、近視野読み出し/書き込みヘッド を光ファイバあるいは半導体導波路に直接結合すること によって、大きくて重いコレクタ・レンズの使用しない で済ますことができるようになり、浮上ヘッドあるいは 接触ヘッドの機械的設計を単純化することが可能となる ことである。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかし、このような小 さいアパーチャーを使用すると、先細の光ファイバ先端 部のような従来の近視野デバイスを介する伝送は厳しい 減衰を受け、その結果は、読み出し用には低く過ぎる信

る。E. Betzig et al., "Near-Field Optics: Microsco py, Spectroscopy, and Surface Modification Beyond t he Diffraction Limit (近視野光学機器:回折限界を超 える顕微鏡法、分光学及び表面改質)", Science, Vol. 257, pp. 189-194 (1992年)、及び G. A. Valaskovic e t al., "Parameter Control, Characterization, and O ptimizatoin in the Fabrication of Optical Fiber Ne ar-Field Probes (光ファイバ近視野プローブの製造に おけるパラメタ制御、キャラクタリザーション及び最適 化)", Applied Optics, Vol. 34, No. 7, pp. 1215-122 7 (1995年)参照。結果として、近視野光学系を使用する 実用的な光データ記憶読み出し/書き込みヘッドは、今 までに得られていない。

【0009】したがって、短いピット長寸法を備え、し たがって高データ密度と高速の読み出し/書き込み速度 をもたらし、厳しい減衰を受けず、したがって相変化媒 体のような光記憶媒体上のデータの書き込み及び読み出 しをともに可能にする、近視野光学系を用いる光データ 記憶媒体のための読み出し/書き込みヘッドが、必要で

【0010】本発明の目的は、プラズモン効果で増幅さ れた透過光を提供する光記憶媒体用の読み出し/書き込 みヘッドを提供することである。

【0011】本発明の他の目的は、近視野光学系を使用 する光記憶媒体用の読み出し/書き込みヘッドを提供す ることである。

【0012】本発明のさらに目的とするところは、光記 億媒体のピット長の寸法を短縮し、したがって高いデー タ密度と高いの読み出し/書き込み速度を与える、光記 憶媒体用の読み出し/書き込みヘッドを提供することで ある。

【0013】本発明のさらに他の目的は、厳しい減衰を 受けず、したがって光記憶媒体上のデータの書き込み及 び読み出しの両方が可能である、光記憶媒体用の読み出 し/書き込みヘッドを提供することである。

【0014】本発明のさらに他の目的は、正確に整列さ れ、プラズモン効果で増幅された透過光を提供する、光 記憶媒体用の読み出し/書き込みヘッドの配列体を提供 することである。

[0015]

【課題を解決するための手段】一般的に言えば、本発明 により、光記憶媒体用の読み出し/書き込みヘッドが提 供される。本発明の読み出し/書き込みヘッドは、端面 を有する導波路と、導波路の端面に設けられたプラズモ ン増幅デバイスとを有す。プラズモン増幅デバイスは第 1の表面及び第2の表面を有する金属膜を有し、第1の 表面は導波路の端面に固定されており、金属膜は金属膜 を通して設けられたアパーチャーを有する。金属膜は、 金属膜の第1及び第2の表面の少なくとも一方の上に設 けられた周期的な表面トポグラフィー(topography:形 50

状構造)を有する。金属膜の表面の一方に入射する光は 金属膜の表面の少なくとも一方での表面プラズモン・モ ードと相互作用し、それにより、光記憶媒体に導かれた 及び/または光記憶媒体から集められ金属膜内のアパー チャーを通る透過光が、増幅される。さらに、一体の光 源を有する読み出し/書き込みヘッドが提供される。

【0016】これに加え、光記憶媒体用の正確に整列さ れた読み出し/書き込みヘッドの配列体も提供される。 配列体は、それぞれ端面を有しすべての端面はほぼ同じ 平面内に配置されている複数の導波路と、各導波路の端 面の上にそれぞれ設けられたプラズモン増幅デバイス と、を有している。各プラズモン増幅デバイスは、第1 の表面及び第2の表面を有する金属膜を有し、第1の表 面は対応する導波路の端面に固定されており、金属膜は 金属膜を通して設けられたアパーチャーを有する。金属 膜は、金属膜の第1及び第2の表面の少なくとも一方の 上に設けられた周期的な表面トポグラフィーを有する。 金属膜の表面の一方の上に入射する光は、金属膜の表面 の少なくとも一方での表面プラズモン・モードと相互作 用し、それにより、光記憶媒体に導かれた及び/または 光記億媒体から集められた金属膜内のアパーチャーを通 る透過光を増幅する。一体の光源を有する正確に整列さ れた読み出し/書き込みヘッドの配列体も提供される。

【0017】さらに、新規の端面発光レーザ及び増幅さ れた透過光を有する垂直共振器面発光レーザ(VCSE L: vertical cavity surface-emitting laser) も提供 される。

【0018】このようにして、本発明によれば、光記憶 媒体用の高解像度の読み出し/書き込みヘッドが提供さ れる。この読み出し/書き込みヘッドは、通常、近視野 光学系を利用する。特に、読み出し/書き込みヘッドに は、光記憶媒体の上のピット長の短縮を可能にする、波 長以下のアパーチャーが設けられる。その結果、高デー 夕密度、及び、選択された走査速度において従来技術に よる光読み出し/書き込みヘッドよりも高いデータスル ープットを提供する。重要なことは、本発明の読み出し /書き込みヘッドにおける波長以下アパーチャーを介す る透過光が、プラズモン増幅デバイス(以下「PED」 とも表記する)の使用により、表面プラズモンとの相互 作用により増幅されることである。読み出し/書き込み ヘッドの導波路の端面は金属膜で覆われており、金属膜 を通して発光(emission)モードあるいは集光(collectio n)モード(あるいはその両方)で、波長以下のアパーチ ャーが光を透過させる。増幅された光透過は、光記憶媒 体の読み出しあるいは書き込みに使用される光と読み出 し/書き込みヘッドの金属膜の表面上の表面プラズモン との共鳴相互作用の結果である。共鳴は、金属膜の表面 トポグラフィーの設計により、所望の波長に調整するこ とが可能である。デバイスの分解能は、アパーチャーの 直径により決定される。本発明による読み出し/書き込

20

みヘッドを介する透過率は、読み出し/書き込みアパー チャーの直径が光学的波長より大幅に小さいときでも、 (読み出し/書き込みアパーチャーの面積に入射する電 力に対して正規化した場合) 1を超えることができる。 Ebbesen et al, 前掲; T. Thio et al., "Surface-Pla smon Enhanced Transmission Through Hole Arrays inC r Films (クロム膜における孔の配列を通る表面プラズ モン増幅透過)", Journal of the Optical Society of America B, Vol. 16, No. 10, pp. 1743-1748 (1999年) 参照。

13

[0019]

【発明の実施の形態】次に、本発明の好ましい実施の形 態について、図面を参照して説明する。

【0020】図1(A)は、光記憶媒体への書き込み及 び/または光記憶媒体からの読み出しのための本発明に よる読み出し/書き込みヘッド100を示している。本 明細書において使用される「光記憶媒体」は、光を使用 してデータが書き込まれ及び/または読み取られる任意 の媒体を意味し、DVD及びCD-ROMのような光デ ィスクならびに光テープあるいは光磁気材料のような他 の形式の光媒体で使用されるような相変化媒体を含む が、相変化媒体に制限されるものではない(光磁気材料 の場合には、読み出しのみが光学的に行われ、書き込み は磁気的に行われる)。 さらに、本明細書において使用 される「読み出し/書き込みヘッド」は、光記憶媒体に データを蓄積する(「書き込み」)及び/または光記憶· 媒体に蓄積されたデータを取り出す(「読み出し」)デ バイスを意味する。本発明における読み出し/書き込み ヘッドには、読み出しのみ、書き込みのみ、あるいは読 み出し及び書き込みの両方を行うことができるものが含 まれる。

【0021】図1(A)に示す読み出し/書き込みヘッ ド100は、導波路10及びプラズモン増幅デバイス (「PED」) 20を備えている。導波路10は好まし くは光ファイバからなるが、導波路10は、半導体基板 上に作られた導波路のような当該技術分野において公知 の光を導くための任意の他の適切な導波路からなってい てもよい。導波路10は、データが読み取られ及び/ま たはデータが書き込まれる光記憶媒体50に、読み出し 及び/または書き込みの際に近接して位置する端面12 を備えている。導波路10は、読み出し/書き込みヘッ ド100の端面12における面積を最小にするように先 細とすることができ、これは、光記憶媒体50の表面か ら所要の波長以下(subwavelength)距離 z 以内に読み出 し/書き込みヘッドを維持するために望ましいことであ ろう。距離 z はアパーチャーの直径程度とすべきであ り、zはアパーチャーの直径の約1.5倍以下であるこ とが望ましい。アパーチャーの直径の約1.5倍を超え るzの値はビームの回折を生じ、分解能が失われる。さ らに、導波路端面の面積を最小限度に抑えることは、ス

キューのような効果を含む、その面積上の全体の粗さを 最小限度に抑える。例えば、導波路端面の直径が500 nmであれば、5mmの場合よりも、導波路端面を表面 から50nm以内に保つことは、機械的に容易である。 【0022】上述のように、読み出し/書き込みヘッド 100はプラズモン増幅デバイス20をも含む。プラズ モン増幅デバイス20は、導波路10の端面12の上に 設けられており、導波路10から光記憶媒体50に向か って光が進むか、あるいは光記憶媒体50から導波路1 10 0へ逆方向に光が進むかにかかわらず、プラズモン増幅 デバイス20を通過する光の透過強度を大きくする。プ ラズモン増幅デバイス20は、貫通したアパーチャー3 0を有する好ましくは銀である金属膜22を有し、貫通 したアパーチャー30の寸法がデバイスの分解能を決定 する。アパーチャー30は直径dを有し、直径dはアパ ーチャーに入射する光の波長以下であることが好ましい (すなわち、アパーチャーは波長以下の直径を有するこ とが望ましい)。読み出し/書き込みヘッドの分解能 は、好ましくは光記憶媒体の上のピットの寸法に適合す べきである(すなわちほぼ等しくするべきである)。ピ ット寸法及び読み出しヘッドの両方の精密な分解能が望 ましいが、このような分解能には、光記憶媒体自体の分 解能や読み出し/書き込みヘッドを介して通過する光の 全強度のような制限がある。実際には、読み出しに対し ては、(読み出し/書き込みヘッドに多くの場合に内蔵 されたディジタル信号処理プロセサを使用して、かなり の誤り訂正が通常実行されることを念頭において、)妥 当な誤り率を得るために十分なだけ信号対雑音比は高く なければならない。さらに厳しい実用上の必要条件が、 書き込みのための光の強度に適用される。相変化光記憶 媒体の場合には、書き込みび光強度は、媒体を局部的に 融解するために(例えば、結晶質から非晶質に変化させ

【0023】金属膜22には、金属膜22の2つの表面 の少なくとも1つの上に、周期的な表面トポグラフィー 40がさらに設けられている(2つの表面は、導波路1 0の端面12に隣接する第1の表面と、第1の表面に対 向し光記憶媒体50に面する第2の表面である)。周期 的な表面トポグラフィー40は、金属膜22の2つの表 面のいずれかあるいは両方の上に設けることができる が、表面特徴40は導波路10の端面12に隣接する、 金属膜22の第1の表面上にのみ設けることが望ましい と考えられている。周期的な表面トポグラフィー40 は、(ほぼ平坦な表面とは対照的に)表面特徴として知 られる持ち上げられた領域及び/または押し下げられた 領域を有し、このような表面特徴は、周期的を有して、 すなわち規則的に繰り返されるパターンでもって、配列 している。表面特徴の周期性は、増幅された集束光(enh anced light collection)の波長を決定するために重要 であり、1998年12月9日に出願された、Ebbesenらの米国

るために)十分なだけ高い必要がある。

特許出願第09/208,116号にさらに詳細に説明されてい る。さらに、Gruppらの前掲を参照。周期的な表面トポ グラフィー40の例は、図1(B)に示すような小さな くぼみ(dimple)あるいは半球形の突出部の正方格子配列 であるか、あるいは図1(C)に示すような1組の同心 の持ち上げられたかあるいは押し下げられた環である。 その格子定数 [図1(B)に示す場合] あるいは半径 [図1 (C) に示す場合] は、読み出し/書き込みヘッ ド100と連係して使用される読み出し/書き込み用の レーザの波長に調整される。1998年12月9日に出願され たEbbesenらの米国特許出願第09/208,116号、Gruppらの 前掲書、H. F. Ghaemi et al, "Surface Plasmons Enha nce Optical Transmission Through Subwavelength Hol es (サブ波長穴を介する表面プラズモン強化光伝送) ", Physical Review B, Vol. 58, No. 11, pp. 6779-6782 (1998年)を参照。上記の例示的な周期的な表面トポグ ラフィーは単なる実施例であり、本発明を制限するもの ではない。より正確に言えば、周期的な表面トポグラフ ィー40の他の構成も可能であり、それらは本発明に包 含される。この構成によれば、金属膜の表面の一方に入 射する光は、金属膜の表面の少なくとも一方での表面プ ラズモン・モードと相互作用し、その結果、金属膜内の アパーチャーを介する透過光を増幅する。

【0024】プラズモン増幅デバイス20内のアパーチ ャー30は円形であってもよいが、長方形、あるいは楕 円形、あるいは光記憶媒体50のトラックピッチ及び最* 少ピット長に適合する他の形状でもよい。例えば、図1 (D) は、全体として楕円形のスリット形状を有するア パーチャー30とともに同心の丸められた長方形の持ち 上げられあるいは押し下げられた環からなる周期的な表 面トポグラフィー40を有するプラズモン増幅デバイス を示している。スリットが使用され、かつスリット長 (スリットの最も長い方の寸法である) がプラズモン増 幅デバイス20を介して透過する光の光学的波長の2分 の1より大きければ、共振及びスリット自身の内側の導 波路モードも、増幅された光透過をもたらす。 J. A. P orto et al., "Transmission Resonances on Metallic Gratings with Very Narrow Slits (非常に狭いスリッ トを有する金属格子上の伝送共振) ", Physical Revie w Letters, Vol. 83, No. 14, pp. 2845-2848 (1999 年)を参照。スリット形のアパーチャーを使用する場合 には、スリット幅(スリットの最も短い寸法の幅であ る) は、アパーチャーに入射する光の波長以下であるこ とが望ましい(すなわち、この場合にはアパーチャーの 直径となるスリット幅は、波長以下である)。さらに、 読み出し速度を最大化するために、スリットの望ましい 方向は、スリットの最も長い寸法方向がデータトラック に対して垂直になるような方向である。

【0025】図1(A)に示すように、必ずしも必要ではないが、プラズモン増幅デバイス20の金属膜22の 50

第2の表面(すなわち、金属膜22の光記憶媒体50に 対向する表面)の上にオーバー・レイヤ24を設けるこ とも望ましい。オーバー・レイヤ24は、光学的に透明 な誘電体材料からなる。オーバー・レイヤ24は、読み 出し/書き込みヘッド100、特にプラズモン増幅デバ イス20を、光記憶媒体50の表面への衝突を原因とす る損傷ないしは他の損傷から、保護することができる。 さらに、オーバー・レイヤ24は、プラズモン増幅デバ イス20を介するさらに増幅された光透過をもたらすこ とができる。具体的にいうと、導波路10の屈折率とほ ぼ等しい屈折率を有するオーバー・レイヤ24の材料を 選択することにより、プラズモン増幅デバイスを介する 全透過光がさらに増幅される。例えば、導波路10が非 晶質のシリカ光ファイバであれば、導波路の屈折率とほ ぼ等しい屈折率を有するように、オーバー・レイヤ24 も非晶質のシリカで作ることができる。実験的に、屈折 率を整合したオーバー・レイヤ24によるこのさらなる 増幅は、プラズモン増幅デバイス20を介する光透過を さらに10倍高めることが示されている。この効果は、 1999年11月5日に出願された、Kimらの米国特許出願第09 /435,132号に、さらに詳細に説明されている。また、A. Krishnan etal., "Enhanced Light Transmission by Resonance Tunneling Through Subwavelength Holes(波 長以下穴を介する共鳴トンネリングによる増幅された光 透過) ", NEC Research Institute, Inc. Technical Re port, No. 99-152 (1999年)参照。さらに、オーバー・ レイヤ24を構成する材料は、機械的に堅牢であること が望ましく、また、読み出し/書き込みヘッドの光記憶 媒体への予期しない「衝突」(すなわち機械的接触)を しばしば伴うような温度上昇を、失敗なく吸収するのに 適していることが望ましい。

【0026】本発明の読み出し/書き込みヘッド100は、発光器(light emitter)及び集光器(light collector)として作動し、したがって、当該技術分野において理解されるように、発光(emission)モード及び集光(collection)モードの両方で動作する。すなわち、読み出し/書き込みヘッドは、発光モードでは光源として作動し(したがって光記憶媒体50を照明する)、集光モードでは集光器として動作する(したがって、光記憶媒体50により反射され、光記憶媒体50により屈折され、あるいは光記憶媒体50を介して透過した光を集める)。本発明の読み出し/書き込みヘッド100を介する光透過は、発光モード及び集光モードの両方で高く、本発明の読み出し/書き込みヘッド100は、両方のモードで同時に使用することが可能である。

【0027】図2は、光記憶媒体50の読み出しに使用される光の光路の1例を概略的に示している。ここでは、媒体の反射率の変調として、光記憶媒体50上にデータが記録されている。この説明図において、本発明の

読み出し/書き込みヘッド100は、発光モード及び集 光モードの両方で同時に使用される。光源200 (通常 は半導体レーザであるが、本発明においては任意の光源 であってよい)からの光は、通常はレンズ210を使用 して、ビームスプリッタ220及びファイバ・カプラ2 30を介して、読み出し/書き込みヘッド100の導波 路10の中へ導かれる。読み出し/書き込みヘッド10 0のプラズモン増幅デバイス20は、光データ記憶媒体 50にごく近接して走査される。光データ記憶媒体50 は、プラズモン増幅デバイス20を介して透過してきた 光を反射し、次に反射された光は、同じ装置により集め られる。すなわち、反射光は、まずプラズモン増幅デバ イス20を介して集められ、次に導波路10を介して伝 送され、次にビームスプリッタ220を通過しさらに通 常は集束レンズ240を通過した後に、検出器250に より集められる。(当該技術分野において知られている ように、光を導くために光ファイバ導波路を使用するこ とにより、レンズ210,230,240を省略するこ とが可能である。) 当該技術分野において知られている ように、検出器の出力は、通常、ディジタル信号処理ユ 20 ニット(図示せず)に供給される。

17

【0028】データ転送速度をさらに向上するために、 読み出し/書き込みヘッド100の配列体を使用しても よい。その結果、ここでNを配列体内の読み出し/書き 込みヘッドの数として、データ転送速度はN倍に増加す る。読み出し/書き込みヘッドの配列体は、別の光記憶 技術である光テープと連係させて使用した場合に、極め て有用である。光テープでは、データは、テープの長さ 方向に通常は垂直であるトラックに書き込まれる。デー タは、テープに沿って(しかも極めて接近して)読み出 し/書き込みヘッドを走査することにより、読み出され あるいは書き込まれる。 W. S. Oakley, "A Novel Digi tal Optical Tape Recorder (新規のデジタル光テープ レコーダ) ", Proceedings of the SPIE, Vol. 2604, p p. 256-262 (1996年)参照。読み出し/書き込みヘッド の1次元配列体は、読み出し及び書き込み速度を改善 し、(例えば光テープの場合に) 横方向の動きが不要と なるので、ヘッドの位置決めのための制御機構の機械的 設計を著しく単純化する。実際には、Nは読み出し/書 き込みヘッド配列体の機械的必要条件により制限され る。従来技術によるデバイスでは、最大の難問は、すべ てのN個の読み出し/書き込みヘッドを光記憶媒体の表 面から距離 z ≦ z = x (図 2 参照) 内に維持することで あり、ここでzax は、ピット長(典型的には50n m)程度である。参考までに、磁気記録媒体の読み出し のために使用される浮上ヘッド(flyhead)は、磁気記録 媒体の上に30nmの距離をおいて位置している。この 距離は、まもなく、より新しい技術により約10nmに まで減少される可能性がある。また接触スライダ磁気へ ッド(contact slider magnetic head)を使用して約5 n

mの距離を使用する方式の提案がされている。従来技術 によるデバイスは、先細の光ファイバを配列したものを 利用しようと試みており、これはその先細の端部を正確 に整列する必要がある。1本1本が別々の光ファイバ端 部をこのように正確に整列させることの難点は、無視で

【0029】読み出し/書き込みヘッドの配列体を使用 するとき、複数の読み出し/書き込みヘッドを相互に整 列させることはさらに重要である。読み出し/書き込み ヘッドの配列体を半導体ウエハの上に作製することによ り、この問題には対処できる。参考文献として本明細書 に包含されるSolinらへの米国特許第5,646,051号明細書 参照。

【0030】図3(A)は、単一の半導体ウエハから形 成された読み出し/書き込みヘッド100のこのような 1次元配列体300を示す。導波路10は、当業者には よく知られた方法で、光学的リソグラフィーにより半導 体ウエハから作製される。導波路は高さhであって、こ の高さhは、導波路を介して進む光の波長の少なくとも 約半分(すなわち 1/2)であることが望ましいが、当 該技術分野において公知であるように、導波路と周囲の 媒体(例えば空気)の間の屈折率の差にも依存する。光 記憶媒体上のデータトラックを照明するためのレーザダ イオード(図示せず)及び読み出し/書き込みヘッド自 体は、当該技術分野において公知であるように、完全に モノリシックな設計のために、同じ半導体ウエハの上に 作製することが可能である。完全にモノリシックな設計 によれば、他の方法においては難度の高い作業であるレ ーザと導波路のアライメントを不要にする。導波路面 1 2を劈開することは、原子レベルでの滑らかさをもたら す。劈開された導波路端面12の各々の上に、望ましく は銀である金属膜22が蒸着あるいはスパッタされ、引 き続いて、上述のように周期的な表面トポグラフィー4 0を有するようにパターニングされる。各導波路10の 軸の中心に、それぞれ、金属膜22を貫通する単一のア パーチャー30が設けられており、これにより、複数の プラズモン増幅デバイス20を形成している。各プラズ モン増幅デバイス20は、それぞれ1つの導波路10に 位置決めされている。図3(A)においてアパーチャー 30は円形であるように示されているが、上述のよう に、他の幾何学的形状が望ましいこともある。読み出し /書き込みヘッド配列体300は、金属膜22の外部表 面とその上に形成されたプラズモン増幅デバイス20を 有する配列体面310を含んでいる。配列体面310に おいて、プラズモン増幅デバイス20は、相互に平行で あって、ディスク上のトラックのピッチ△Rと等しい距 離だけすぐ隣りに隣接するPEDと間隔をおいて配置さ れている。このような読み出し/書き込みヘッド配列体 300を使用することにより、複数の光ビーム I1,

I2, ..., Ixを、配列体内の読み出し/書き込みへッ

ド100ごとに1つの光ビームずつ、配列体300を通して伝送することができる。

19

【0031】図3(B)は、導波路10の1つの長手軸 における、図3(A)の読み出し/書き込みヘッド配列 体300の断面図である。このデバイスは、上述のよう に、読み出し/書き込みヘッドを保護しかつプラズモン 増幅デバイス20を介する透過をさらに増幅するため に、オーバー・レイヤ24によって被覆されている。し たがって、オーバー・レイヤ24は、非常に硬いことが 望ましく、その上に金属膜が堆積される材料 (この場合 10 は、導波路10自体)の屈折率とほぼ等しい屈折率を有 することが望ましい。所望であれば、導波路10と金属 膜22の間に中間材(intervening material)を使用して もよい。読み出し/書き込みヘッド配列体300が接触 スライダ・ヘッドとして使用されるのであれば、(接触 部分における反射を最小限度に抑えるように)オーバー ・レイヤ24が存在する場合にはオーバー・レイヤ24 の屈折率に一致するか、あるいは(オーバー・レイヤ2 4が存在しない場合には上述のように透過光をさらに増 幅するように)導波路10の屈折率に一致するか、滑り 動作に必要ないずれかの適切な屈折率を有する潤滑材が 選択されるべきである。配列体面310の付近の下側基 板25をエッチングすることは、読み出しヘッドを媒体 の近視野距離内に維持することを容易にするため面の全 面積を最小限度に抑えるために、望ましいことがあろ う。

【0032】図3(A)及び(B)に示す読み出し/書 き込みヘッドの1次元配列体構成において、プラズモン 増幅デバイス間の中心間の距離が (CD-ROMあるい はDVDのような現行の光記憶媒体のトラックピッチを 反映して) $\Delta R = 1$. $6 \mu m$ であれば、隣接する読み出 し/書き込みヘッドの間にクロストークはないであろ う。表面特徴に対するプラズモン増幅デバイスのアパー チャーの位置がその試料の幅にわたって変化するような 試料では、試料を通した透過光はそれに応じて2μmの 長さにわたって変化し、透過光増幅の高度に局所的な性 質を明示する。1998年12月9日出願のEbbesenらの米国特 許出願第09/208,116号参照。さらに、最近接の表面特徴 (例えば小さなくぼみ(dimple)) の1つあるいは2つの 「シェル(shell)」のみで、十分な透過光増幅を得るの に十分であることが明らかにされた。Thioらの前掲書を 参照。用語「シェル」は、固体物理学の分野において良 く知られている。各シェルは、アパーチャーから同じ距 離に位置する一群の表面特徴からなる。例えば、正方格 子の配列に対して、1番目のシェルは、最も近い隣接表 面特徴(この場合、4つの表面特徴は正方形の頂点を構 成している)からなる。2番目のシェルは、次に最も近 い隣接表面特徴この場合、4つの表面特徴は対角線上に ある) からなる。以下、同様である。例えば、赤色レー ザ $(\lambda = 635 nm)$ が、円形のアパーチャー、及び導 50

波路に隣接する金属膜の表面の上に設けられた表面特徴 としての小さなくぼみとともに使用されるのであれば、 アパーチャーと各プラズモン増幅デバイス内の隣接する 表面特徴(この場合は小さなくぼみ)の間の距離は、約 (600/n) [nm] とするべきである。ここで、n は、金属膜22の上の表面特徴に隣接する誘電材料(例 えば、表面特徴が金属膜22のオーバー・レイヤ24の 側にあれば、オーバー・レイヤ24)の屈折率である。 これは、直接隣接する2つの円形のアパーチャーの間の 中点まで 0.8μmの距離内に、収容されることができ る。導波路の屈折率を考慮すると、隣接表面特徴のいく つかのシェルを各アパーチャーの周りに収容することが できるように、小さなくぼみの周期は0. 2μmとする べきである。クロストークをさらに減少させるために、 1998年12月9日に出願されたEbbesenらの米国特許出願第 09/208,116号に説明するように、アパーチャーを異なる 波長、例えば635nm及び830nmに対して交互に 最適化することが可能である。

【0033】波長以下アパーチャーの配列体と、したがって読み出し/書き込みヘッドの配列体を作製するための別の幾何学的形状は、半導体ウエハの上に作製された切頭体構造の配列体である。図4に示すように、シリンあるいはGaAs(ガリウムヒ素)ウエハのような光学的に透明な半導体ウエハ80をエッチングを使用する。とが望ましい)、1つ以上の切頭体構造90を作る。切頭体構造の1つ1つが、読み出し/書き込みヘッドのための導波路として作用する。これらの切頭体構造は、一般に、頂点を有しない角錐状の構造であると考えることができる。各切頭体構造90は、図示するようにその上にプラズモン増幅デバイスが設けられることとなるほぼ平坦な頂面92と、ベース94と、複数のファセット96とを含んでいる。

【0034】切頭体構造は、正方形のベース(したがっ て4つのファセット)を有することが望ましいが、他の 切頭体ベース形状(例えば、三角形、その場合切頭体は 3つのファセットを有する)を使用することも可能であ る。これらの切頭体構造は、切頭体が角錐であり角錐の 頂点が存在していればその角錐の頂点があるであろう位 置のすぐ下の高さの位置に、切頭体構造のベース上に平 面波で入射する透過光(図4の例における光ビームⅠ、 及び12により示すような光)を集束することが、明ら かにされている。切頭体はその高さで終端され、切頭体 のベースに入射する光(例えば、切頭体の下に作られる VCSELからの光)に対して高いスループットが与え られる。図に示すように、各切頭体構造の頂面上にプラ ズモン増幅デバイス20を設けることにより、上述と同 様にして、高いスループットはさらに増強される。この ようなデバイスの分解能は、プラズモン増幅デバイスの 金属層内のアパーチャー30の寸法により決定される。

このような切頭体構造の配列体は、直截的な方法で作製 することができる。光源が、Heisigらにより最近示され たように、切頭体の下方に作製することができる垂直共 振器面発光レーザ(VCSEL; vertical cavity surf ace-emitting laser、以下参照) の配列体である場合 に、これは特に有用である。 S. Heisig et al., "Optic al Active Gallium Arsenide Cantilever Probes for C ombined Scanning Near-Field Optical Microscopy and Scanning Force Microscopy (複合走査近視野光学顕微 鏡法及び走査力顕微鏡法用の光学的に活性的なガリウム ヒ素カンチレバープローブ) ", Journal Vac. Sci. Tec hnology B, Vol. 18, No. 3 pp. 1134-1137 (2000); S. Heisig et al., "Gallium Arsenide Probes for Scann ing Near-Field Probe Microscopy (走査近視野プロー ブ顕微鏡法用のガリウムヒ素プローブ) ", Applied Phy sics A, Vol. 66, pp. S385-S390 (1998年)を参照。 【0035】一般的には、高屈折率の半導体の角錐状の 構造は、そのベース上に入射する光を、まさしく頂点の わずかに下の位置に集中させることが知られている。 K. Iga, "Surface Emitting Laser (面発光レーザ)" Electronics and Communications in Japan, Part 2, V ol., 82, No. 10, pp. 70-82 (1999年); K. Goto, "Pr oposal of Ultrahigh Density Optical Disk System Us ing a Vertical CavitySurface Laser Array (垂直共振 器面発光レーザ・アレイを使用する超高密度光ディスク 装置の提案)", Japanese Journal of Applied Physic ' s, Vol. 37, Part 1, No. 4B, pp. 2274-2278 (1998 年); Y. -J. Kim et al., "Fabrication of Micro-Pyram idal Probe Array with Aperture for Near-Field Opti cal MemoryApplication(近視野光メモリ応用のための アパーチャーを有するマイクロ・ピラミッド状プローブ ・アレイの製作) ", Japanese Journal of Applied Phy sics, Vol. 39, Part 1, No. 3B, pp. 1538-1541 (2000 年)を参照。本発明において、高い解像度を保ちながら 可能な最高のスループットを得るためには、光の強度が 最も高い位置に頂面92が設けられるように、各切頭体 構造90が作られることが望ましい。プラズモン増幅デ バイス20は、上述のように読み出し/書き込みヘッド の所望の分解能に適合する波長以下アパーチャー30を 備え、その頂面上に設けられる。この複数チャネルのデ

【0036】本発明により構成された読み出し/書き込みへッドの配列体は、このように、各ヘッドごとに読み出し及び書き込みの両方が可能であり、これは著しい利点である。通常は、独立した読み出しヘッド及び書き込みヘッドは不要であり、したがって、独立した読み出し 50

バイスは、優れた高さの均一性(すなわち、平坦な頂面

92が位置する高さにおいて)で切頭体構造を作製でき

る利点を有し、したがって、このような均一性に対して

最も厳しい条件を有する接触スライダ・ヘッドに使用す

るのにも適している。

ヘッド及び書き込みヘッドを整列させることに関連する 難点を解消する。光ファイバ導波路を使用して作製され た本発明の読み出し/書き込みヘッドに対して、入力電 カ100mW、ファイバ・コアの直径3~4μmにおい て、特に、透過光をさらに強化するために上述のように 屈折率を整合させた誘電体オーバー・レイヤ24が使用 されているのであれば、光媒体に対する現行の書き込み ヘッドで使用される電力密度に匹敵する約10[™]W/m *の出力電力密度を得ることが可能である。光がより小 さい面積の中に閉じ込められその結果として電力密度が 増加するように、より小さいコアを有する導波路用光フ ァイバを使用することにより、あるいは、光ファイバあ るいは他の導波路の端部をわずかに先細にすることによ り、出力電力密度をさらに高めることが可能である。上 述のように、半導体内の切頭体構造は、光強度を出力面 に集中するためにも使用することができる。

【0037】図1乃至図3に示すように、ある種の応用 分野においては、光源あるいは検出器から独立している 読み出し/書き込みヘッドを使用することは都合が良い が、他のある種の応用分野においては、光源が読み出し /書き込みヘッドと一体の部品であることは、有利なこ とがある。この非常に緊密な構成を実現する1つの方法 は、半導体レーザの出力鏡内にピンホール・アパーチャ ーを作製したPartoviらにより示された構成を利用する ことである。 A. Partovi et al, "High-PowerLaser Li ght Source for Near-Field Optics and its Applicati on to High-Density Optical Data Storage(近視野光 学系用の大パワーレーザ光源及び高密度光データ記憶へ のその応用) ", Applied Physics Letters, Vol. 75, N o. 11, pp. 1515-1517 (1999年)を参照。アパーチャー の直径は、光学的波長を十分下回るように選ぶことがで きる。出力鏡の材質が金属であれば、波長以下の径の出 カアパーチャーを介する透過は非常に小さく、出力直径 dが減少すると、(d / λ)の4乗にほぼ比例して減少 すると予想される。ここでλは、光学的波長である。H. A. Bethe, Physical Review, Vol. 66, Nos. 7 and 8, pp. 163-182 (1944年)を参照。本発明によれば、この ようなレーザの出力結合は、出力アパーチャーを介する 表面プラズモン増幅透過を使用することにより、大幅に 増強することが可能である。

【0038】図5は、後部鏡62及び前方の出力鏡64により画定された共振器(キャビティ)を含む、本発明に基づいて構成されたレーザ60を概略的に示す。出力鏡64において、アパーチャー30は、非常に高い解像度でレーザ光が結合することを可能にする。レーザの一般的な構造及び動作は当該技術分野において公知である。しかし、本発明においては、出力アパーチャーから出射する光の透過効率を高めるプラズモン増幅デバイスを作るために、出力鏡のレーザとの界面に周期的な表面トポグラフィー40を設けている。周期的な表面トポグ

ラフィーにおける表面特徴の周期性は、表面プラズモン の分散と周期的な表面トポグラフィーへの格子結合(gra ting coupling)に応じて、レーザの波長に適合するよう に選択されるべきである。 Ghaemiらの前掲書を参照。 レーザ自体は、任意の従来のレーザを含む任意のレーザ でよい。例えば、レーザは、共振器鏡の1つが波長以下 の出力アパーチャーを有する、(Ar, N2, CO2, H e-Neのような) ガスレーザでよい。ここで、波長以 下の出力アパーチャーにはそれを取り囲む周期的な表面 トポグラフィーが付随している。別の可能なレーザとし 10 ては、同様に改良された出力カプラを有する、(ルビ ー、YAG(イットリウム・アルミニウム・ガーネッ ト)、Ti:サファイアのような) 固体レーザであり、 ここでは出力カプラは利得媒体(gain medium)の面上に 直接作製することができる。レーザは、後方鏡(back mi rror)がファイバ格子からなっていてもよいファイバレ ーザでも良い。どのようなレーザも本発明に包含され る。なお、光源が読み出し/書き込みヘッドと一体の部 品であるこれらの実施の形態においては、光源は、光記 億媒体に書き込むため、あるいは光記憶媒体を照明する ためのいずれにも使用することが可能である。したがっ て、このような照明からの反射あるいは屈折された光 は、光記憶媒体のどちらの側に位置してもよい集光器に よって、あるいは複合された光源及び検出器として、集 めることができる。検出器あるいは集光器は、近視野モ ードあるいは遠視野モードのいずれで動作してもよい。 【0039】本発明の読み出し/書き込みヘッドのため に最も望ましいレーザは、半導体レーザである。半導体 レーザは、(例えば、図5に示すように)端面発光でも よい。その場合、光はヘテロ接合あるいは量子井戸66 に対してα方向に閉じ込められる。さらにいっそう魅力 的な代案は、図6(A)に示す垂直共振器面発光レーザ (VCSEL; vertical cavity surface emitting las er)である。一般的には、VCSEL共振器は、当業者 には公知のように、レーザ波長に適合した構造を有する GaAs/AlGaAs多重層からなる2つの分布ブラ ッグ反射器 (DBR; distributed Bragg reflector) 70により画定される。 高スループットを有する波長以 下の分解能を得るためには(図6(B)参照)、前方側 のDBR70を、金属膜リフレクタ22を有するプラズ 40 モン増幅デバイス20に置換してもよい。この金属膜リ フレクタ22には、周期的な表面トポグラフィー40に より囲まれた波長以下の直径のアパーチャー30が作製 される(図6(B), (C)参照)。VCSELの非常 に魅力的な特徴は、大きい配列体の製造が簡単なことで ある。図6(D)は、各出力に増幅透過波長以下のアパ ーチャーを有するプラズモン増幅デバイスを設けたVC SEL配列体の平面図を示す。VCSEL間の間隔に対 する配慮は、実際にはVCSEL配列体のすべての素子

が同じ波長で動作し、各VCSELの横方向の寸法につ 50

いての必要条件により間隔が制限されるおそれがあることを除き、読み出し/書き込みヘッド配列体(図3参照)について上述したものと同じである。

【0040】特定の用途で使用するための増幅された光透過を有するさまざまな種類の光記憶媒体用読み出し/ 書き込みヘッドについて説明し例示したが、ここに添付する特許請求の範囲によってのみ制限されるべきである本発明の技術思想と広範囲の教示を逸脱せずに、変形及び修正が可能であることは当業者には明白であろう。

[0041]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、波長以下のアパーチャと周期的な表面トポグラフィーとを有する金属膜を有するプラズモン増幅デバイスを使用し、表面プラズモンとの相互作用によりアパーチャーを通る透過光が増幅されるようにすることにより、短いピット長寸法を備え、高データ密度と高速の読み出し/書き込み速度をもたらし、厳しい減衰を受けず、相変化媒体のような光記憶媒体上のデータの書き込み及び読み出しをともに可能にする、近視野光学系を用いる読み出し/書き込みへッドが得られる、という効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】(A)は、端面に作られたプラズモン増幅デバ イスを有する先細の光ファイバを備える本発明の読み出 し/書き込みヘッドの断面図(必ずしも正確な縮尺では ない)である。(B)は、本発明の読み出し/書き込み ヘッドに有用なプラズモン増幅デバイスの第1の形態の 平面図であり、プラズモン増幅デバイスは、単一の波長 以下円形アパーチャーを取り囲んでいる、小さなくぼみ からなる正方格子配列を有する表面トポグラフィーを有 する。(C)は、本発明の読み出し/書き込みヘッドに 有用なプラズモン増幅デバイスの第2の形態の平面図で あり、プラズモン増幅デバイスは単一の波長以下の円形 アパーチャーを取り囲んでいる小さなくぼみ(溝)の同 心の環を有する表面トポグラフィーを有する。(D) は、本発明の読み出し/書き込みヘッドに有用なプラズ モン増幅デバイスの第3の形態の平面図であり、プラズ モン増幅デバイスは、波長以下のスリットを取り囲んで・ いる溝パターンを有する表面トポグラフィーを有する。

【図2】本発明の読み出し/書き込みヘッドのための光路の一例の該略図である。

【図3】(A)は、本発明により単一のウエハ上にモノリシックに作製された読み出し/書き込みヘッドの配列体の、部分的に破断図で示された、斜視図である。(Bは、導波路の1つの縦軸を通して見た図3(A)のデバイスの断面図である。

【図4】本発明による、半導体ウエハから作製された複数の切頭体構造で構成された読み出し/書き込みヘッドの配列体の断面図であり、読み出し/書き込みヘッドのそれぞれはプラズモン増幅デバイスを備えている。

【図5】表面プラズモン増幅透過を示す小さいアパーチ

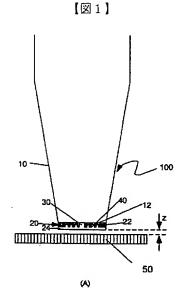
ャーを有する共振器鏡を有する、本発明により作られたレーザの断面図である。

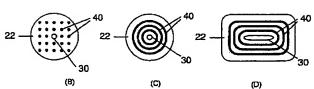
【図6】(A)は、分布ブラッグ反射器(DBR; dist ributed Bragg reflector)により画定された共振器を有する従来の垂直共振器面発光レーザ(VCSEL; ve rtical cavity surface emitting laser)の断面図である。(B)は、本発明により構成された改良されたVCSELの断面図であり、VCSELは増幅透過波長以下のアパーチャーを有する出力カプラーを有する。(C)は、図6(B)の改良されたVCSELの平面図であり、上部金属鏡内の波長以下アパーチャー及び表面特徴*

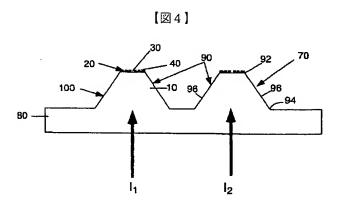
*を示す。(D)は、本発明により構成された改良された VCSELの配列体の平面図である。

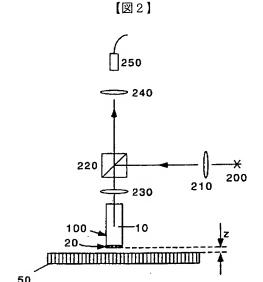
【符号の説明】

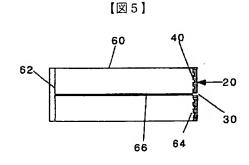
- 10 導波路
- 12 端面
- 20 プラズモン増幅デバイス (PED)
- 22 金属膜
- 24 オーバー・レイヤ
- 30 アパーチャー
- 50 記憶媒体
- 100 読み出し/書き込みヘッド

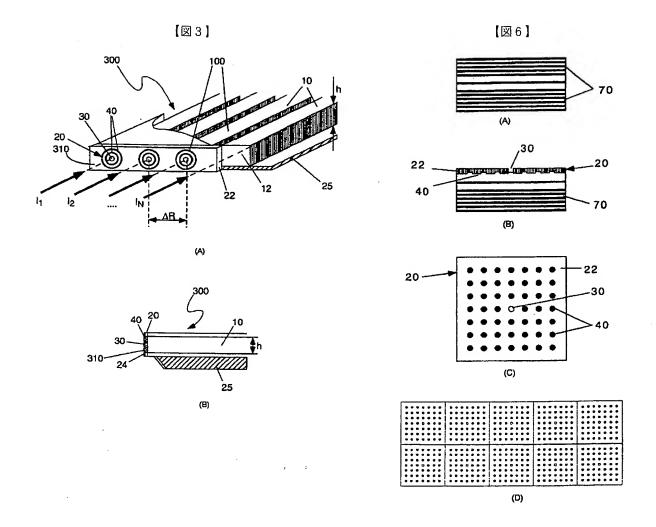












フロントページの続き

(72)発明者 テェニカ・ティオ
アメリカ合衆国、 ニュージャージー
08540、 プリンストン、 インディペン
デンス ウェイ 4 エヌ・イー・シー・
リサーチ・インスティテューテュ・インク

(72)発明者 リチャード・エイ・リンケ アメリカ合衆国、 ニュージャージー 08540、 プリンストン、 インディペン デンス ウェイ 4 エヌ・イー・シー・ リサーチ・インスティテューテュ・インク 内 (72)発明者 トーマス・ダブリュ・エブソン アメリカ合衆国、 ニュージャージー 08540、 プリンストン、 インディペン デンス ウェイ 4 エヌ・イー・シー・ リサーチ・インスティテューテュ・インク

(72)発明者 ヘンリー・ジェイ・レゼック
アメリカ合衆国、 ニュージャージー
08540、 プリンストン、 インディペン
デンス ウェイ 4 エヌ・イー・シー・
リサーチ・インスティテューテュ・インク
内